

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成23年1月6日(2011.1.6)

【公開番号】特開2009-79228(P2009-79228A)

【公開日】平成21年4月16日(2009.4.16)

【年通号数】公開・登録公報2009-015

【出願番号】特願2008-281509(P2008-281509)

【国際特許分類】

C 0 9 K 3/14 (2006.01)

B 2 4 B 37/00 (2006.01)

G 1 1 B 5/84 (2006.01)

【F I】

C 0 9 K 3/14 5 5 0 D

C 0 9 K 3/14 5 5 0 Z

B 2 4 B 37/00 H

G 1 1 B 5/84 A

【手続補正書】

【提出日】平成22年11月15日(2010.11.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

二次粒子の平均粒径が0.05~1.0μmの-アルミナ、中間アルミナ、過酸化水素、酸0.01~5重量%、及び水を含有するpHが1~4の研磨液組成物であって、酸が鉛酸、カルボン酸、メタンスルホン酸、及びヒドロキシリデンジホスホン酸からなる群より選ばれる一種である、磁気ディスク基板用研磨液組成物。

【請求項2】

-アルミナの二次粒子の平均粒径が0.1~0.5μmである、請求項1記載の研磨液組成物。

【請求項3】

-アルミナと中間アルミナの重量比率(-アルミナ/中間アルミナ)が99/1~30/70である請求項1又は2記載の研磨液組成物。

【請求項4】

-アルミナの含有量が、0.05~40重量%である、請求項1~3いずれか記載の研磨液組成物。

【請求項5】

中間アルミナの二次粒子の平均粒径が、0.1~0.5μmである、請求項1~4いずれか記載の研磨液組成物。

【請求項6】

中間アルミナの含有量が、0.05~40重量%である、請求項1~5いずれか記載の研磨液組成物。

【請求項7】

過酸化水素の含有量が、0.002~20重量%である、請求項1~6いずれか記載の研磨液組成物。

【請求項8】

請求項 1 ~ 7 いずれか記載の研磨液組成物を用いて、磁気ディスク基板のうねりを低減する方法。

【請求項 9】

請求項 1 ~ 7 いずれか記載の研磨液組成物を用いて、被研磨基板を研磨する工程を有する、磁気ディスク基板の製造方法。